

Portatore Cestello Di Pulizia Laboratorio Ptfе Personalizzato Resistenza Acidi E Basi Alta Purezza Supporto Wafer Basso Sfondo Contaminazione Zero Rack Per Bagno Chimico

Numero articolo: PL-CP268



introduzione

Scopri i portatori di cestelli di pulizia in PTFE personalizzati ad alta purezza progettati per la semiconduttrice e l'analisi delle tracce. Questi rack resistenti agli acidi garantiscono zero rilascio e livelli di fondo ultra-bassi, fornendo prestazioni affidabili negli ambienti chimici più esigenti per i processi di pulizia di laboratorio di precisione.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Pulizia Wafer Semiconduttori	Trattenere in sicurezza i wafer di silicio durante i processi di pulizia RCA o incisione HF in ambienti di camera pulita.	Previene la contaminazione metallica e garantisce un'esposizione chimica uniforme.
Analisi dei Metalli in Traccia	Pulizia e lisciviazione della vetreria utilizzata per la preparazione dei campioni ICP-OES e ICP-MS per raggiungere la purezza a livello ppt.	Elimina le interferenze di fondo dal materiale del contenitore stesso.
Ricerca sulle Batterie	Manipolazione di materiali di anodo e catodo durante l'immersione in elettrolita o le fasi di trattamento chimico.	Resistenza a solventi organici aggressivi e sali di litio.
Sterilizzazione Farmaceutica	Trasporto di fiale di vetro o componenti di precisione attraverso cicli di sterilizzazione ad alta temperatura o chimicamente aggressivi.	Mantiene la purezza e previene l'adsorbimento superficiale degli ingredienti attivi.
Sgrassaggio Componenti Aerospaziali	Trattenere parti di lega lavorate con precisione durante cicli di pulizia profonda in sgrassanti chimici aggressivi.	Durata a lungo termine in reagenti di pulizia di resistenza industriale.
Fabbricazione di Celle Solari	Supportare substrati fotovoltaici durante la lavorazione chimica umida e le fasi di texturing.	Alta resistenza termica e compatibilità chimica con agenti di incisione.
Preparazione Campioni Geologici	Digestione e pulizia di campioni minerali utilizzando acido fluoridrico concentrato per la determinazione elementare.	Manipolazione sicura in ambienti acidi pericolosi senza degradazione del contenitore.
Categoria Specifica	Dettagli Parametri per PL-CP268	Valori / Capacità
Proprietà del Materiale	Materiale di Costruzione Primario	PTFE Vergine Alta Purezza (Politetrafluoroetilene)
	Sfondo Elementi in Traccia	Ultra-Basso (Adatto per analisi a livello PPT)
	Resistenza Chimica	Universale (Eccezione metalli alcalini fusi/fluoro)
Dimensioni Fisiche	Assorbimento d'Acqua	<0.01%
	Configurazione	Completamente Personalizzabile in base alle Specifiche del Cliente
Limiti Termici	Opzioni di Dimensionamento	Design su misura per wafer da 2", 4", 6", 8", 12" o vetreria personalizzata
	Caratteristiche di Manipolazione	Maniglie integrate opzionali, bracci estendibili o coperchi di blocco
Limiti Termici	Temperatura Massima di Esercizio	260°C (500°F)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Categoria Specifica	Dettagli Parametri per PL-CP268	Valori / Capacità
	Temperatura Minima di Esercizio	-200°C (-328°F)
Dettagli di Produzione	Metodo di Fabbricazione	Lavorazione CNC ad Alta Precisione
	Rugosità Superficiale	Ra 0.4 - 0.8 µm (Standard) / Opzioni lucidate disponibili
	Riferimento Numero Articolo	PL-CP268